

令和元年11月

Photomask Japan 組織委員会
委員長 渡邊 健夫

国際ホトマスクシンポジウム(Photomask Japan)へのご協力をお願い

拝啓 貴社ますますご隆昌のこととお慶び申し上げます。

さて、Photomask Japanはホトマスクジャパン(PMJ)とSPIE(The International Society for Optical Engineering)の主催、BACUS、EMLCの共催を得て、マスクに関する総合的かつ実用的な国際会議として組織されたものです。本会議は毎年4月の3日間、神奈川県横浜市 パシフィコ横浜で開催しており、2020年は4月19日から21日を予定しています。

半導体デバイスの高性能化により、5G通信、AI、IoT、車の自動運転など高度情報化社会へ向かっています。その中、いよいよEUVリソグラフィー(EUVL)が実用化されようとしている一方、低コスト要求の強い半導体デバイスの市場も拡大すると見られ、半導体産業全体が今後も大きく伸張していくものと思われます。

EUVLは今後の微細化を担う最大の製造技術の改革であり、日本はその実用化に欠かせない数多くのサプライヤーが存在し、そのサプライチェーンを担っていますが、マスク関連としてもペリクルを始め、材料・加工プロセス・欠陥検査・修正技術など本格的な量産適用に向けては未だ解決すべき課題が少なくありません。更には次期の高NA化に向けた課題も挙げられています。また、光リソグラフィにおいてもマルチパターンニング、コンピューテーショナルリソグラフィの高度化に対応したマスク関連技術開発が要求されています。高集積化による描画データの大容量化とコンピューテーショナルリソグラフィの高度化要求に対するマスク描画(データ)の高速・高精度処理はEUV/光マスクを問わず益々重要な位置付けとなっています。

また、低コストで微細化を実現するナノインプリントリソグラフィ(NIL)も実用化段階を迎えていますが、マスク(テンプレート)が重要な要素技術であることは相違ありません。今後も市場ニーズに応じて多様化すると見られるパターンニング技術に幅広く応えていく必要があることから、加工プロセスや計測技術など半導体製造との技術交流のため、昨年から会議スコープの拡大を進めています。

マスク技術開発においては、製造装置、材料、プロセス、EDA等の広範囲な要素技術と事業戦略的な課題に加え、FPDをはじめとした低コスト実用プロセスに対する期待が非常に高いと言えます。これらの課題を解決し、高精度化・多機能化・多様化するマスクをユーザーニーズに従ってタイムリーに低コストで提供していくためには、実用の観点から関連分野の研究・技術情報を広く交換していくことが必要です。日本のマスク関連技術は世界をリードする立場にあり、日本で国際会議を開催することは国際間の技術交流、国際協調に寄与する上からも意義が大きいと考えられます。本会議はこのような観点から設立され、今回も参加者数400人規模の国際会議として開催計画を進めています。

つきましては、本会議開催の趣旨とその重要性をご賢察いただき、下記のように貴社のご援助、ご高配を賜りたくお願い申し上げます。

なお、Photomask Japan 2020に対しての寄付によるご援助と、Photomask Japan (2020年度)賛助会員としてのご援助の二通りの方法がございます。貴社のご都合にかなった方法でご協力いただければ幸いです。

会議の情報、Digest of Papers(予稿集)、会務の報告等は、賛助会員、寄付のいずれの場合につきましても送付させていただきます。よろしくご理解の程お願い申し上げます。

敬具

記

1. 賛助会入会の場合は、添付の「賛助会入会申込書」によりお願い申し上げます。

ご寄付いただく場合は、同封の「寄付申込書」によりお願い申し上げます。

2. 払込方法： 下記の口座にお振り込みください。

銀行名： 三菱UFJ銀行
支店名： 新丸の内支店 (店番号 422)
口座番号： (普) 4910525
口座名： Photomask Japan
口座名フリガナ： ホトマスクジャパン

3. 本件照会先、申込書送付先

ホトマスクジャパン事務局 (担当: 佐藤)

〒105-8335

東京都港区芝3-23-1 セレスティン芝三井ビルディング

(株)JTBコミュニケーションデザイン内

電話:03-5657-0777 FAX:03-3452-8550

E-mail:pmj@jtbcom.co.jp

4. お申込期限 2020年4月17日(金)

※2020年2月28日(金)までにお申込の場合は、「Digest of Papers」(予稿集)に社名を掲載いたします。

5. お振込期限 2020年4月17日(金)

以上

添付書類 (1) Photomask Japan 2020 開催趣意書
(2) Photomask Japan 2020 寄付申込書
(3) Photomask Japan 賛助会規程
(4) Photomask Japan 賛助会入会申込書(2020年度)